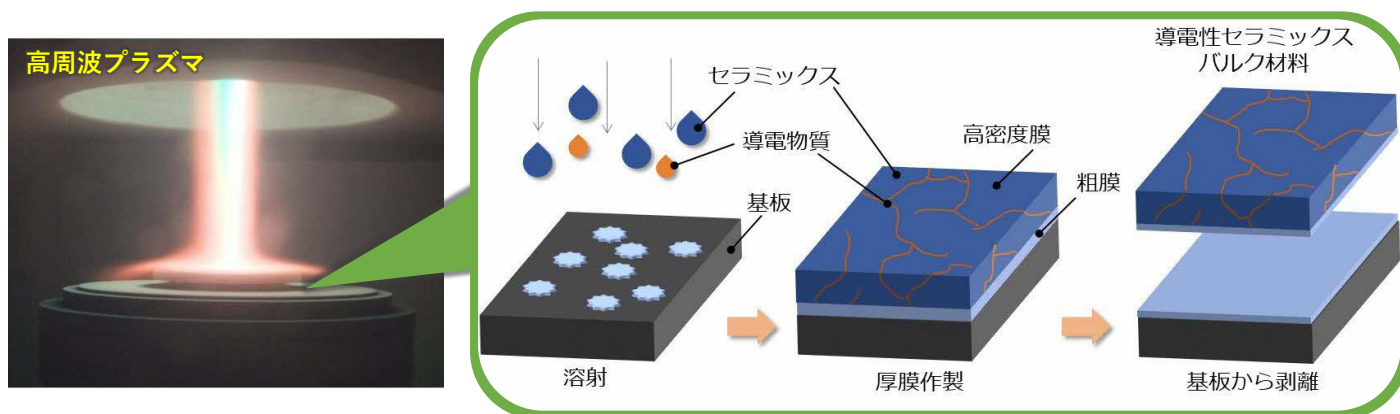


溶射膜及びその製造方法

高周波プラズマ溶射により、耐プラズマ腐食性に優れる酸化イットリウムの薄物バルク材料を製造します。



技術分野 機械・加工
材料・素材の製造

PRポイント 耐プラズマ腐食性と導電性を両立するセラミックス厚膜および製造方法です。
溶射法による皮膜形成ですが、最終的に基材から剥離させることで薄物バルク材料として利用します。
溶射法による成形のため基材形状の自由度が高く、かつ基材は再利用が可能です。

技術概要 高周波プラズマの超高温を利用して原料を完全溶融させることで、セラミックス皮膜の高密度化と、添加材料のセラミックス粒界への偏析を同時に行います。このため低添加量での導電性付与と、セラミックス本来の耐プラズマ腐食性の維持が可能です。製膜した厚膜は基材から容易に剥離でき、バルク材料として利用できます。

用途 半導体製造装置部材（ドライエッチング装置部材、静電チャック用誘電材ほか）
電極材料等への耐薬品性付与
電子機器の帯電防止

基本情報	発明の名称	溶射膜及びその製造方法		
	発明者	小西幹郎、江木俊雄、金山信幸、田中暁巳		
	出願人	住友大阪セメント株式会社、島根県、竹内電機株式会社		
	出願番号	特願2009-111489	出願日	H21.4.30
	公開番号	特開2010-261069	登録番号	特許第5549834号

対応情報	関連特許	有	サンプル提供	無
	許諾実績	無	デモ機など	無
	実施実績	無	展示品	有

お問い合わせ 〒690-0816 島根県松江市北陵町1
島根県産業技術センター 企画調整スタッフ
TEL : 0852-60-5141 E-MAIL:sangisen@pref.shimane.lg.jp